

2025年度 第2回
フットニツクデバイス・応用技術研究会
テーマ『新しい光技術1』

日時：2025年7月23日(水) 13:00 ~ 19:30

会場：古河電気工業株式会社 横浜事業所 講堂

主催：一般財団法人光産業技術振興協会 フットニツクデバイス・応用技術研究会

協力：株式会社オプトロニクス社、株式会社イーエクス プレス

講演プログラム

(講演順、講演題名は変更される場合があります)

13:00 ~ 13:05

事務連絡・幹事挨拶

13:05 ~ 13:55

コヒーレント・トランシーバ用MEMSチューナブルフィルタの
部品実装技術

santec AOC株式会社

次長

近藤 裕司

13:55 ~ 14:05

休憩

14:05 ~ 14:55

実装技術のご紹介 ~フリップチップ実装の基礎から
CP0量産に向けたメンブレンデバイス実装~ (仮)

東レエンジニアリング株式会社

技監

新井 義之

14:55 ~ 15:05

休憩

15:05 ~ 16:30

シリコンフォトニクス基盤技術の先駆的な研究とその応用開拓
(第40回櫻井健二郎氏記念賞 受賞記念講演)

横浜国立大学

大学院工学研究院 知的構造の創生部門 教授

馬場 俊彦

17:00 ~ 19:30

名刺交換会・懇親会(無料) (※別会場にて/ポスターセッションは開催なし)

研究会担当幹事：

三菱電機株式会社 正田 史生

古河電気工業株式会社 吉田 順自

【特別聴講参加費】（研究会非会員1人あたり、消費税込）

一般：18,000 円

会員と同じ企業の紹介者：8,000円（貴社所属の会員有無は、事務局までお問い合わせください）

大学関係者、学生：1,500円

【参加申し込み方法】

下記URLまたは右記QRコードの申込フォームよりお申込みください。

<https://forms.office.com/r/Q0GZvEjyGf>



【講演会場】

古河電気工業株式会社 横浜事業所

〒220-0073 神奈川県横浜市西区岡野2丁目4番3号

JR「横浜駅」西口より徒歩16分、相鉄線「平沼橋駅」より徒歩9分

<https://www.furukawa.co.jp/company/office/yokohama.html>

【懇親会場（17:00開始）】

CRAFT BEER BAR IBREW 横浜西口店

〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2丁目9-9 アネックス横浜 1F

<https://maps.app.goo.gl/KKbimg2r5CHUxW6c6>

講演会場からのルート： <https://maps.app.goo.gl/xpGNvDgwAF2siBoT6>

【問い合わせ先】

一般財団法人光産業技術振興協会

フォトニックデバイス・応用技術研究会 事務局（担当：耕田）

TEL:03-5225-6431 FAX:03-5225-6435

E-mail: pdevice@oitda.or.jp

研究会ホームページ：

<https://www.oitda.or.jp/study/pd/>

oitda フォトニックデバイス

研究会ホームページ

